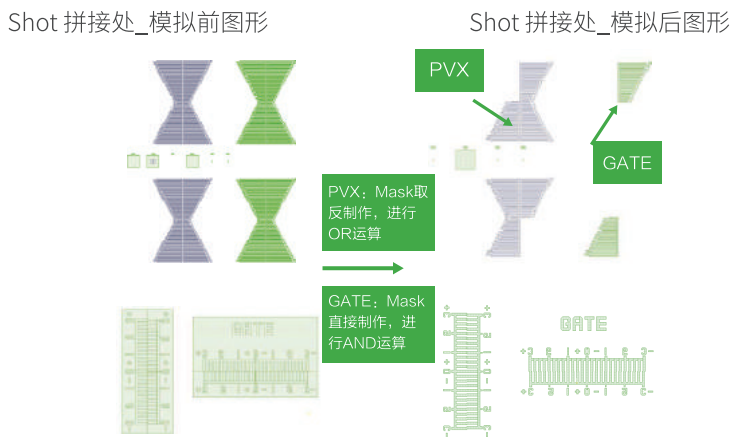


# EmapFPD

(掩膜分析模拟工具套件)

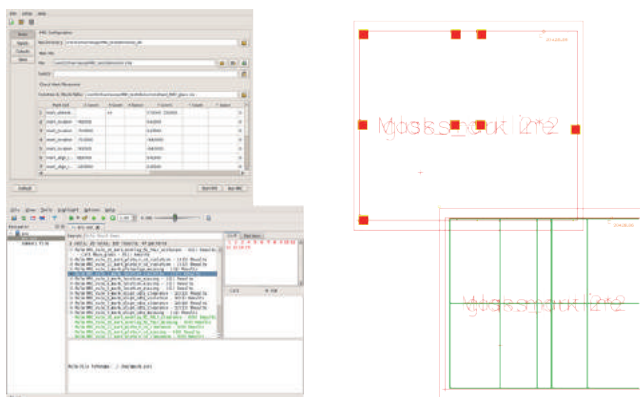
EmapFPD工具提供Mask高级分析模拟功能,包括Exposure Analysis分析, MRC检查, Split Panel, 马赛克分析以及Job File工具等。

- EmapFPD-EA (Exposure Analysis): 曝光分析工具, 避免版图设计在Photo流程中出错, 如图示1所示;



图示1-Exposure Analysis模拟工艺过程

- EmapFPD-MRC (Mark Rule Check): Mark设计规则检查工具, 避免版图上的Mark丢失或净空区出错, 如图示2所示;

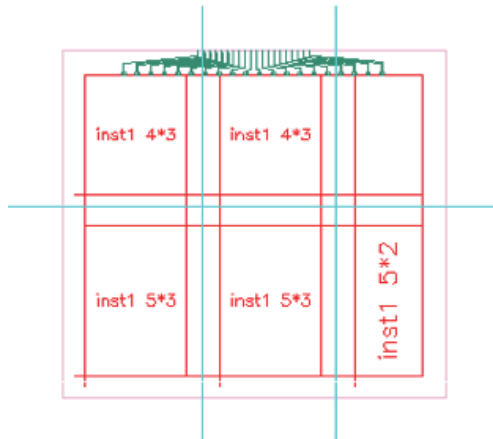


图示2-MRC检查

## 亮点:

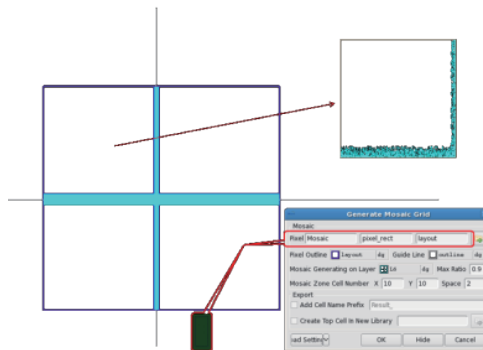
- 支持Mark设计规则及净空区检查
- 支持切割0宽度Path
- 支持重复切割区
- 支持对Array进行切割, 结果保持Hierarchy, 自动创建Cells
- 支持创建IPS等异型结构的Mosaic
- 支持Mosaic和Subpixel Outline错位, 可以使切割部位错开图形, 提高良率
- 支持基于关键词的工艺模板技术
- 支持基于矢量图的缩略图
- 全自动根据模板提取数据, 填写工艺文件

- EmapFPD-SP (Split Panel) :版图切割工具,切割Panel版图产生不同Shot的Mask版图,包含Split Panel和马赛克分析等工具;
- Split Panel :版图切割工具。用以切割Panel版图成不同Shot的Mask版图。在Split Panel中有选项可以调用Mosaic Analysis工具。

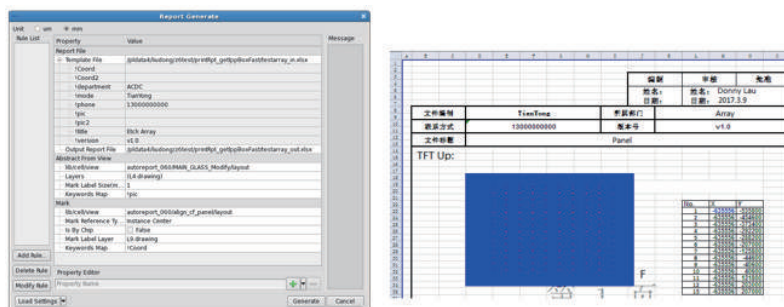


图示3-SplitPanel

- Mosaic Analysis:用以在切割线周围为AA array的每个Shot分别创建随机的马赛克cells。



图示4-马赛克分析



图示5-Job File根据模板自动创建工艺文件